

## 中科院EDA中心自主研发DFM工具 为国内芯片企业提供纳米级芯片技术服务

文章来源：微电子研究所

发布时间：2013-08-21

【字号：小 中 大】

日前，中科院EDA中心陈岚研究员带领的纳米芯片设计方法学研究小组研发的纳米可制造性设计与分析技术（DFM）研究成果开始为国内企业提供服务。

研究成果中，65/45纳米DFM工具已经交付中芯国际20多个License，并为中芯国际商业客户提供DFM检查。同时，中科院EDA中心与中芯国际、中兴微电子等已签订DFM技术服务合同，与展讯、联芯、新岸线正在签订服务合同中，与华为海思的DFM产业服务合同计划于2013年10月启动签订。该工具用于对纳米级芯片加工结果与芯片版图相关性预测，指导半导体加工工艺开发及芯片设计精确时序分析和加工风险的预测及优化。

中科院EDA中心在此项研究工作中积累的自主知识产权，不仅打破了国外EDA公司的行业垄断，更在DFM领域实现从追赶战略向创新跨越战略转型发挥了推动作用。同时，该技术也将促进商业化服务推广应用，预计能为所服务的企业节约上千万美金的高端设计工具费用，帮助企业提升约5%的成品率，提高其代工服务能力和市场竞争力。



45纳米DFM平台